

多元系機能材料研究会企画シンポジウム
「新奇プロセスが拓く多元系材料の高機能化の新展開」
 — プロセスに潜むサイエンス —

| | |
|------|---|
| 内容説明 | <p>イノベーションを生む中核となる先端的高機能デバイスの創生においては、新しい材料の開拓に加えて、デバイス化に向けた革新的プロセスの開発が重要である。材料開拓では、材料設計自由度の拡大のためのひとつの方向である「多元化」が注目されている。しかしながら、プロセスに関しては個々の材料で個別に研究開発され、系統的な理解を深める機会はほとんどなかった。本シンポジウムでは、多元系材料のポテンシャルを最大限に引き出すための薄膜および結晶の新奇プロセスに関する最近の成果と課題について「プロセスに潜むサイエンス」の観点から紹介いただき、多元系材料に有用なプロセスの統一的な理解を深め、多元系の高機能化の方向性について議論する。</p> |
|------|---|

| 講演題目 | 講演時間 | 勤務先 | 講演者名 |
|---|-------------|--------|------|
| イントロダクトリートーク：新奇プロセスが拓く多元系材料の高機能化の新展開 | 13:30~13:35 | 新潟大 | 坪井望 |
| 光励起プロセスを応用した高効率 CIGS 薄膜太陽電池 | 13:35~14:05 | 青山学院大 | 中田時夫 |
| レーザ MEB およびレーザ誘起 VLS 法を用いた人工格子の形成 | 14:05~14:35 | 東京大 | 田畑仁 |
| PLD 法および化学溶液法によるマルチフェロイック薄膜の特性制御 | 14:35~15:05 | 大阪大 | 奥山雅則 |
| エキシマレーザアニーリングによる多元系薄膜の高性能化技術 | 15:05~15:35 | 日本製鋼所 | 清野俊明 |
| 休憩 | 15:35~15:50 | | |
| 二段階気相法を応用した GaN 系積層構造蛍光体粒子の作製 | 15:50~16:20 | 静岡大 | 原和彦 |
| ミスト CVD 法による酸化物薄膜の作製と多元系への展開 | 16:20~16:50 | 京都大 | 藤田静雄 |
| 電子レンジを用いたマイクロ波加熱による I-III-VI ₂ 族半導体の合成 | 16:50~17:20 | 大阪府立高専 | 須崎昌巳 |
| メカノケミカルプロセスとスクリーン印刷/焼結法を用いた CIS 系薄膜の形成と太陽電池への応用 | 17:20~17:50 | 龍谷大 | 和田隆博 |
| クロージング | 17:50~17:55 | 宮崎大 | 吉野賢二 |